

- 当社は、全電気溶融技術をはじめとする技術開発等を推進し、地球温暖化防止に貢献するとともに、持続的な成長と企業価値の向上を目指しております。
- 製造設備のガス燃焼炉を全電気溶融炉に転換するとともに、半導体プロセス用ガラス増産設備の投資を行い、非化石化の推進と炭素生産性の向上を図ります。

## 1. 事業適応計画の実施期間

2024年8月～2026年12月

## 2. 生産性向上目標

「世界一効率の高いモノづくりこそが、世界一環境にやさしいモノづくりにつながる」との考えのもと、付加価値額の増大と炭素生産性を287.6%向上を目標とします。

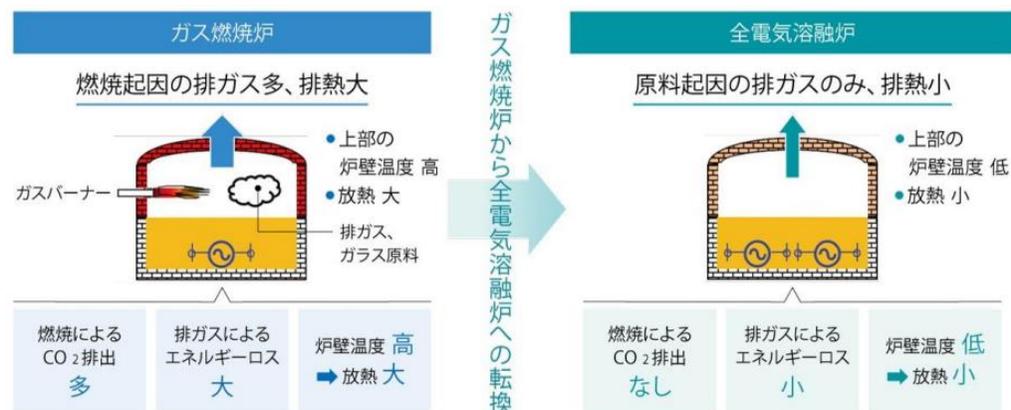
## 3. 前向きな取組の内容

ガラス製造設備をガス燃焼炉からエネルギー効率が優れた全電気溶融炉に転換します。  
半導体プロセス用ガラスの生産能力の増強を図るため、高効率生産ラインを導入します。

## 4. 支援措置

税制措置（カーボンニュートラルに向けた投資促進税制）

### <取組の内容のイメージ>



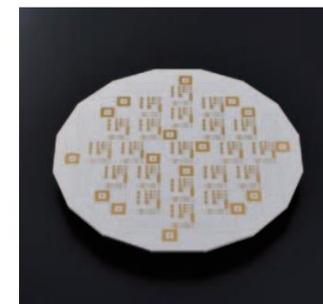
### ■ 半導体プロセスで使用される当社製品

半導体用サポートガラス



最先端の半導体プロセスで治具として使用されるガラス基板。優れた平坦性や高強度などが求められる

プローブカード用基板



シリコンウェハ上に形成された半導体チップの電氣的検査器具に使用される基板